# 超短パルスレーザーを用いた電場の遠隔計測

# Remote sensing of electric field using ultrashort laser pulses

藤井 隆<sup>1,2</sup>, 鈴木 大樹<sup>2</sup>, 山崎 修平<sup>2</sup>, 江藤 修三<sup>1</sup>, アレクセイ ジドコフ<sup>1</sup>, 堀田 栄喜<sup>2</sup>, 根本 孝七<sup>1</sup> Takashi Fujii<sup>1,2</sup>, Daiju Suzuki<sup>2</sup>, Shuhei Yamasaki<sup>2</sup>, Shuzo Eto<sup>1</sup>, Alexei Zhidkov<sup>1</sup>, Eiki Hotta<sup>2</sup>, Koshichi Nemoto<sup>1</sup> <sup>1</sup>電力中央研究所,<sup>2</sup>東京工業大学

<sup>1</sup>Central Research Institute of Electric Power Industry, <sup>2</sup>Tokyo Institute of Technology

Abstract: Since the excitation of molecules by electron collisions in the presence of an external electric field depends on the field strength, the emission of molecules in the ultraviolet range is expected to be sensitive to the field strength. We investigated the relationship between the external electric field and the fluorescence intensities of nitrogen molecule when the laser energy was changed. The increase of the fluorescence intensity started at the lower external electric field, down to ~2 kV/cm, with the higher laser energy.

## 1. はじめに

大気中における電場分布を、遠隔において非破 壊で時間分解計測することができれば、雷現象等 地球物理の研究や、電気設備の設計、診断、保護 技術は一層発展すると考えられる。我々はこれま で、超短パルスレーザー誘起フィラメントプラズ マ<sup>[1,2]</sup>中窒素分子発光強度の外部電場依存性を利 用した電場の遠隔計測を提案し、その基礎特性を 測定してきた<sup>[3-5]</sup>。

外部電場中においてフィラメントプラズマは紫 外領域で発光する。電場中にプラズマが存在する と、電離、励起、再結合、付着等、大気中におい て様々な物理過程が生じるが、分子の電子-電子 遷移を励起できる電子の数は外部電場強度と共 に指数関数的に増加する。このため、外部電場中 にプラズマが存在すると、分子のイオン化や励起 が促進される一方、プラズマの再結合は緩和され る。電子衝突によりプラズマは加熱され、プラズ マからの紫外発光の強度と寿命は増加すると考 えられる。従ってプラズマの紫外発光はプラズマ が存在する空間における電場計測に有用である。

今回、フィラメントプラズマ中窒素分子発光強 度の外部電場依存性の、レーザーエネルギー強度 に対する特性を測定したので報告する。 60mmの球を用い、その先端から130mm離れた位 置に直径220mmの円盤を接地電極として設置し た。パルス幅70fs、繰り返し10HzのTi:Sapphire レーザーパルスを、焦点距離2mの凹面鏡を用い て集光し、フィラメントプラズマを生成した。レ ーザー光軸と高圧電極との間隔は5mmとした。 高圧電極には負極性直流電圧を最大-80kVまで印 加した。

フィラメントプラズマからの発光は、高圧電極 から 1m の距離に設置したレンズによりコリメー トした後、光ファイバを通して焦点距離 300mm の分光器 (Roper Scientific; SP-2358-P) により分光 し、インテンシファイヤ付 CCD (ICCD) カメラ (Roper Scientific; PI-MAX: 1K-UV-MgF2) により 受光した。



Fig. 1. Experimental setup.

#### 2. 実験系

実験配置を Fig.1 に示す。高圧電極には直径

#### 3. 実験結果

分光計測により得られた、波長 337.1nm におけ る窒素分子の第2正帯 ( $C^3\Pi_u \rightarrow B^3\Pi_g$ )の発光スペ クトルを Fig.2 に示す。この時、レーザーエネル ギーは 180mJ であった。印加電圧が 0kV の時に比 べて-80kV の場合、発光強度が明らかに増加して いることが分かる。レーザーエネルギーを 90mJ、 135mJ、180mJ と変化させた時の、発光強度の印 加電圧依存性を Fig.3 に示す。図中の電場強度 *E* は、高圧電極に最も近いフィラメント位置におけ る値(以下、フィラメント位置での電場強度と呼 ぶ)であり、

$$E = -U_0 D / (2R^2)$$
 (1)

により求めた。ここで、U<sub>0</sub>は印加電圧、Dは球電極の直径、Rは球電極中心からの距離である。

図より分かるように、発光強度は外部電場に対 して指数関数的に増加した。さらに、レーザーエ ネルギーを増加すると全体的に発光強度が増加 し、それに伴い、より低い電場において発光強度 の増加が開始していることが分かる。レーザーエ ネルギーが 90mJ の時には、窒素分子の発光強度 は、フィラメント位置での電場強度が 7.3kV/cm (U<sub>0</sub>=-30kV)まではほとんど変化が観測されなか ったが、レーザーエネルギーが 180mJ の時には、 電場強度が 2.4kV/cm (U<sub>0</sub>=-10kV)以上において、 発光強度の増加が開始することが示された。これ は、フィラメントプラズマにより供給される初期 電子数が増加したためと考えられる。



Fig. 2. Fluorescence spectra of  $N_2$  molecules in the vicinity of filament plasma at the applied voltage of 0kV and -80kV.



Fig. 3. Applied voltage dependence of  $N_2$  fluorescence intensity when the laser energy is changed.

## 4. まとめ

超短パルス高強度レーザーにより誘起される フィラメントプラズマを外部電場中に生成し、プ ラズマの発光スペクトルの計測を行った。窒素分 子の発光強度は外部電場に対して指数関数的に 増加した。さらに、レーザー強度を増加すること により、外部電場が 2.4kV/cm 以上において、発 光強度の増加が開始することが示された。

#### <u>参考文献</u>

[1] A. Braun et al, "Self-channeling of high-peak-power femtosecond laser pulses in air", Opt. Lett. **20**, pp. 73-75 (1995).

[2] A. Couairon and A. Mysyrowicz, "Femtosecond filamentation in transparent media", Phys. Rep. 441, pp. 47–189 (2007).

[3] 杉山 他、第27回レーザセンシングシンポジ ウム予稿集、pp. 40-41、2009.

[4] K. Sugiyama et al., "Laser-filament-induced corona discharges and remote measurements of electric fields", Opt. Lett. **34**, pp. 2964-2966 (2009).

 [5] K. Sugiyama et al., "Submicrosecond laser-filament-assisted corona bursts near a high-voltage electrode", Phys. Plasmas 17, 043108 (2010).